

Web版

平成19年12月
COCN税負担率研究会

世界各国企業における税負担実態調査報告書

(税負担率に焦点を当ててもものづくりの国際競争力を考える)

産業競争力懇談会税負担率研究会

目次

1、エクゼクティブサマリー	3 p
2、はじめに	5 P
3、調査の方法	5 P
4、諸外国における産業政策の実態	6 P
5、各種産業における税負担率の国際比較	7 P
6、産業政策と設備投資の関係	1 1 P
7、各国における産業振興策例	1 3 P
8、我が国の産業競争力を強化するために	1 4 P

付属資料集目次

各国産業政策集		ページ
	米国	15
	シンガポール	16
	中国、韓国、台湾、その他アジア	16
	EU諸国(オランダ、ベルギー、英国)	17
	日本	17
	米国雇用創出法詳細	17
世界各国実効税率推移		18
法人税率国際比較(日本の税制構造による国際比較)		20
	企業の財務データに基づく実質税負担率の業種別の国	
	法人所得課税が企業の立地選択に及ぼす影響	
主要産業における地域別シェア推移		21
	半導体産業、液晶パネル製造産業、鉄鋼産業、自動車	

1、エグゼクティブサマリー

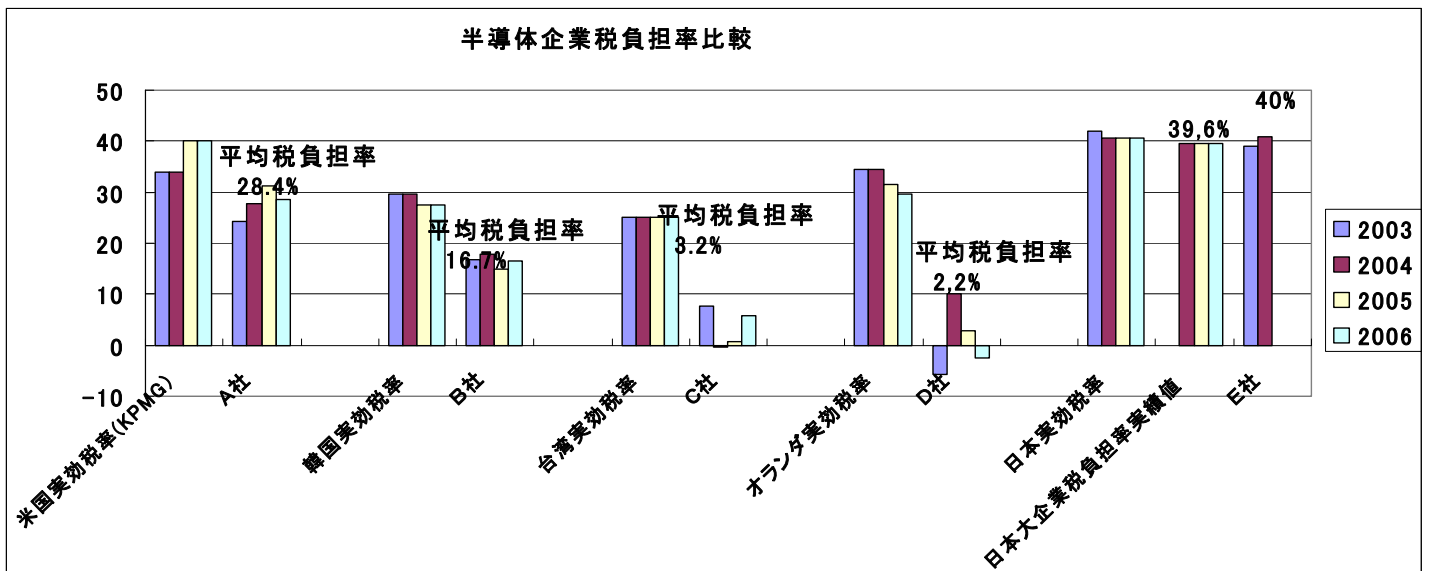
①我が国の産業競争力を高めていくためには企業努力に加えて国際的に高い法人税負担を見直すことが必要とされています。より多くの利益剰余金を研究開発、投資に振り向けることにより企業の国際競争力が高まるからです。

国際的に活動している企業が公開している財務資料（SEC年度報告書他）から税負担に焦点を当てて調査したところ海外企業の法人税負担は我が国企業に較べて著しく低いこと、海外諸国は我が国より充実した産業振興政策を採っていることが明らかになりました。これら産業支援策は一部の国だけでなく先進国を含めて多くの国々において実施されています。

調査対象は半導体産業、液晶パネル産業、化学材料産業、建設産業及び半導体製造装置産業とし、法人税率としての実効税率によらず税前利益に対して実際に負担した実質税負担率を調査しました。調査結果は米国主要企業が20%台後半、台湾企業は一桁、韓国は10%台後半、多くの欧州企業においても30%台前半を下回った税負担率であり、実効税率が低いことに加えて国の産業政策が反映された結果、日本企業の税負担率実績平均値39,6%を大幅に下回っていることが明らかになりました。

②半導体産業例示

税負担の国際比較(半導体産業での例示)



産業政策(各社annual report, SEC報告書記載より)

米国:輸出優遇税制、雇用創出法による製造所得税額控除...

韓国:投資税額控除(投資額の10~15%税額控除...設備投資額が大きい半導体、液晶での政策効果大)

台湾:先端技術投資企業5年免税

オランダ:Tax holiday(外国からの新技術投資優遇)

③各国における産業振興施策例

米国；雇用創出法による国内雇用確保・投資促進、海外子会社の配当金還流減税等あらゆる施策を展開。州レベルにおいても充実。

アジア諸国；先端産業投資促進、企業誘致により雇用確保。

欧州；先進国においては金融企業・研究開発型企業振興・誘致が中心。国土資源が乏しい国・後進国では産業誘致促進。

発展途上国；租税回避地（tax haven）として製造・金融・IT企業誘致。シンガポールは製造、先端企業、金融、研究開発、産業振興・誘致等々。

④我が国の産業競争力を強化するためには海外競争相手と平等な戦いができるよう、一企業の努力では克服できない国際的に著しく高負担の実質税負担を改善する施策が重要な鍵を握っていると考えられます。

具体的な直近の目標として

1) 研究開発をより活発に行うことを促進する施策

中長期目標として

2) 海外子会社で蓄積された利益を国内へ還流する際の課税を適正化すること

3) 国際的に **Equal Footing** な競争条件としての企業税制

が必要になってきています。

2、はじめに

我が国の半導体・液晶産業が技術面で優れていたにもかかわらず「競争力を失ってしまったのはなぜか？」との問いに対して一つの回答を出したいという思いからこの研究会を始めました。公開情報により半導体・液晶産業企業の財務データを調べたところ税前利益に対する実質の税負担において我が国と韓国・台湾及び米国企業に大きな差が存在し、しかも税負担が少ない企業が大きな成長を遂げている事実が明らかになりました。両分野においては競争力を高めるためには他社に先駆けて巨額の先端設備投資を行う戦略が必要になります。

研究会では半導体・液晶産業に加えて化学産業、建設産業及び半導体製造装置産業について、法定税率としての実効税率によらず公表されている企業の財務情報等を調べることにより、内外企業の実際の税負担と産業税制の実態を調査しました。その結果アジア諸国だけでなく米国を始めとする欧米先進国においても我が国にない産業政策が広く存在し自国産業の国際競争力を高めている実態が明らかになってきました。

我が国において税の高負担が続くと比較的参入が容易な産業にとどまらず我が国が得意とする基幹産業においても競争力が失われ地盤沈下がますます加速していくものと考えられます。

3、調査の方法

研究会では半導体産業のほか液晶パネル産業、化学産業、建設産業及び半導体製造装置産業分野企業における実際の税負担の国際比較を行いました。我々の調査は企業から公表されている年度報告書、SEC（米国証券取引委員会）報告書のPL、キャッシュフロー計算書、税額計算書明細等公開情報及び諸官庁、JETRO、各国州ホームページ、新聞記事等から調べたものです。今回の税負担率国際比較は各国特有の産業振興策（税額控除等）が反映された実際の負担率で比較したものであり、内外税率差のみに着目した従来の国際比較とは異なります。さらにこうした公表データから国による産業政策の具体的内容が明らかになりました。（資料集15ページ、各国産業政策集参照）

なお本調査に当たっては研究会会員が所属産業分野における競争力の高い企業を国籍によらず選定し調査したものです。

注；本研究での税負担（率）は実効税率でなく実際に企業が負担した税負担をいう

実効税率：国、州、地方で定めた法人税率

実質税負担率=法人所得税（実効税率準拠）±税額控除等（tax credit）

／財務会計税前利益×100%

4、諸外国における産業政策の実態

国際競争力強化に向けての動き

国際的に事業を展開している企業・産業は国際競争力を高めるためにマネジメント、技術開発を始め様々な施策を実行してきました。一方国家レベルにおいても自国経済の活性化を通じて社会の安定、国力を高めていくことを目的として自国産業の育成・国際競争力を高める政策を強烈に打ち出してきています。産業のグローバル化が進んで来た今日、原材料・製造設備は広く世界各国から調達されてきています。製造原価の大きなコストを占める人件費については主要な経営判断として低人件費国への事業拠点移動により低減してきており先進国においては国内産業の空洞化をもたらしてきました。

国際競争力を高めている国々は税制を一つの軸として産業振興を図っている

研究会にて公表企業データから各国企業の実態を調べたところアジア諸国に限らず欧米先進国においても国策として税制を中心とする産業振興策を充実させ、自国の産業競争力を高め、国内経済の活性化を図っている実態が明らかになりました。

法人税率としての実効税率でなく税前利益に対して実際に負担した実質税負担率（実際の税負担／税前利益×100%）を調査した結果、米国主要企業が20%台後半、台湾では一桁、韓国においても10%台後半の税負担となっていました。一方多くの日本企業は実効税率40.7%に近い負担となっています。

アジア諸国企業においては国家の政策を受けて巨大な先端設備投資を行い世界に冠たる地位を占めています。投資税額控除他により多額の税額控除資金を先端設備への投資に向けた結果、韓国・台湾企業は半導体・液晶分野において大きな成功を収めました。米国では旧くから産業振興が行われてきましたが、最近では輸出優遇政策（外国貿易所得控除法）がWTO違反裁定を受けたため、製造業振興策への転換を図っています。製造所得税額控除及び国内投資を条件に海外子会社で蓄積された留保利益の米国への還流を促す減税政策により国内投資・雇用増を促進しています（米国雇用創出法）。これら産業政策は従来からの研究開発促進に加え製造力強化段階に的を絞ったものです。欧州先進国では多国籍企業の経営統括社への税優遇、新技術企業優遇、研究開発優遇など様々な優遇・誘致政策を採っています。シンガポールは製造、開発、高付加価値産業誘致にあらゆる政策を導入し多国籍企業の誘致による経済活性化に成功しています。

これら政策は法定税率としての実効税率ではその実態が分からず、企業が公表している年度報告書、SEC（米国証券取引委員会）への年度報告書等によりはじめて明らかになったものであり、特に設備投資が競争力を左右する産業において多大な影響を与えるものと考えられます。

5、各種産業における税負担率の国際比較

調査期間は 2003 年～2006 年とし、企業の税負担率及び所属国における実効税率及び日本大企業税負担率実績値 39,6 %（2004 年～2006 年平均値、経済産業省調べ）を明示しました。諸外国企業では実効税率が低い事にとどまらず国からの産業政策による税額控除により日本企業に比べ大幅に法人税負担が少なくなっています。

注 1) ; 平均税負担率 = Σ 実際の税負担 / Σ 税前利益（損失は除く） × 100%

（各年単純平均とは差が出る）

税前利益赤字かつ税還付の場合は+に表示される

注 2) 会計年度の定義 ; 決算期 1 月～6 月は前年度決算分とし、7～12 月決算は当年度とする

図－1 半導体産業

米国A社 20%台後半、韓国B社 10%台後半、台湾C社、オランダD社一桁、日本大企業は 40%弱。

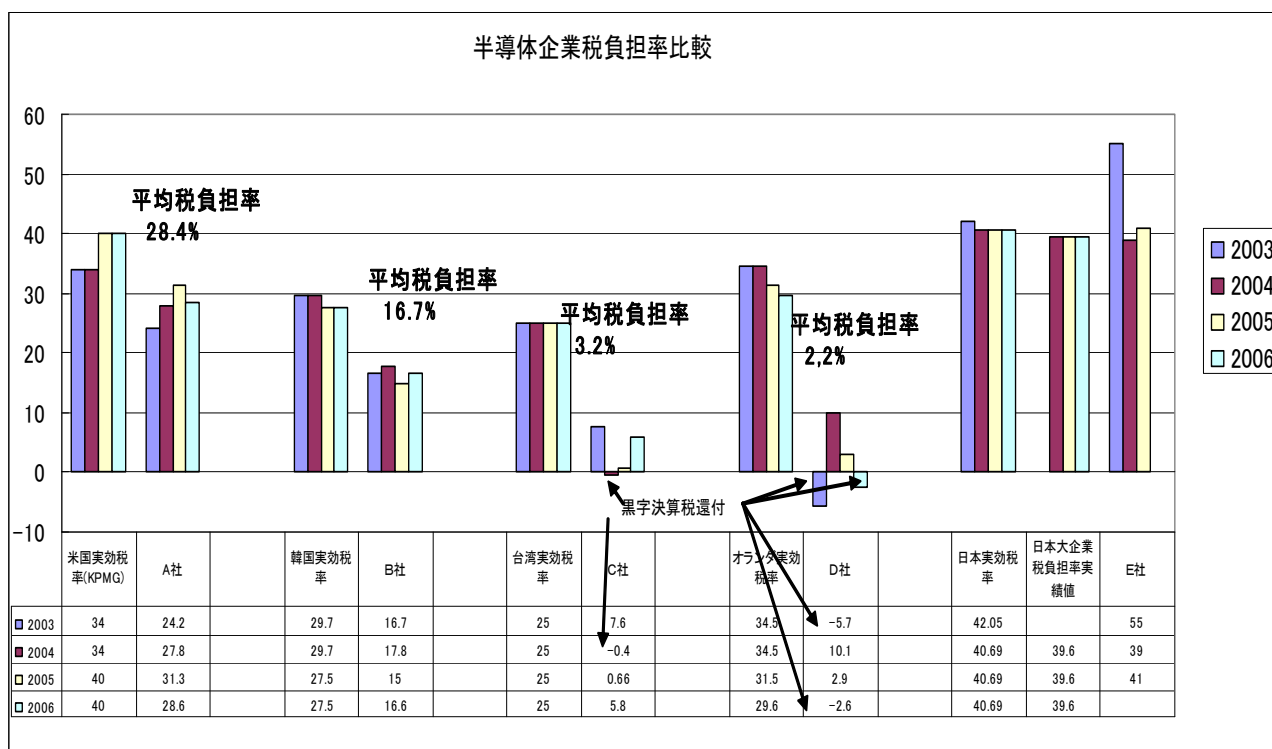


図-2 液晶パネル産業

日本のシェアは80%（1996年）から10%台（2006年）へと激減している（資料集22ページ参照ください）

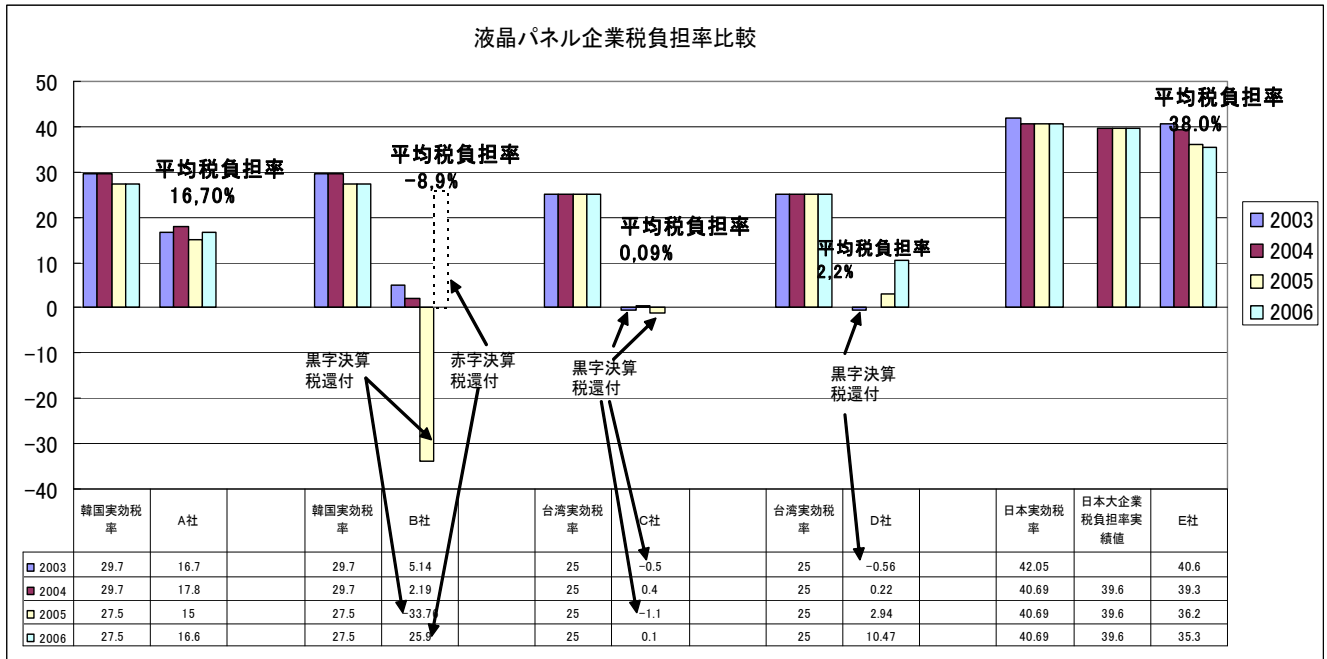


図-3 化学産業

ドイツは法人税率引き下げが予定されています。

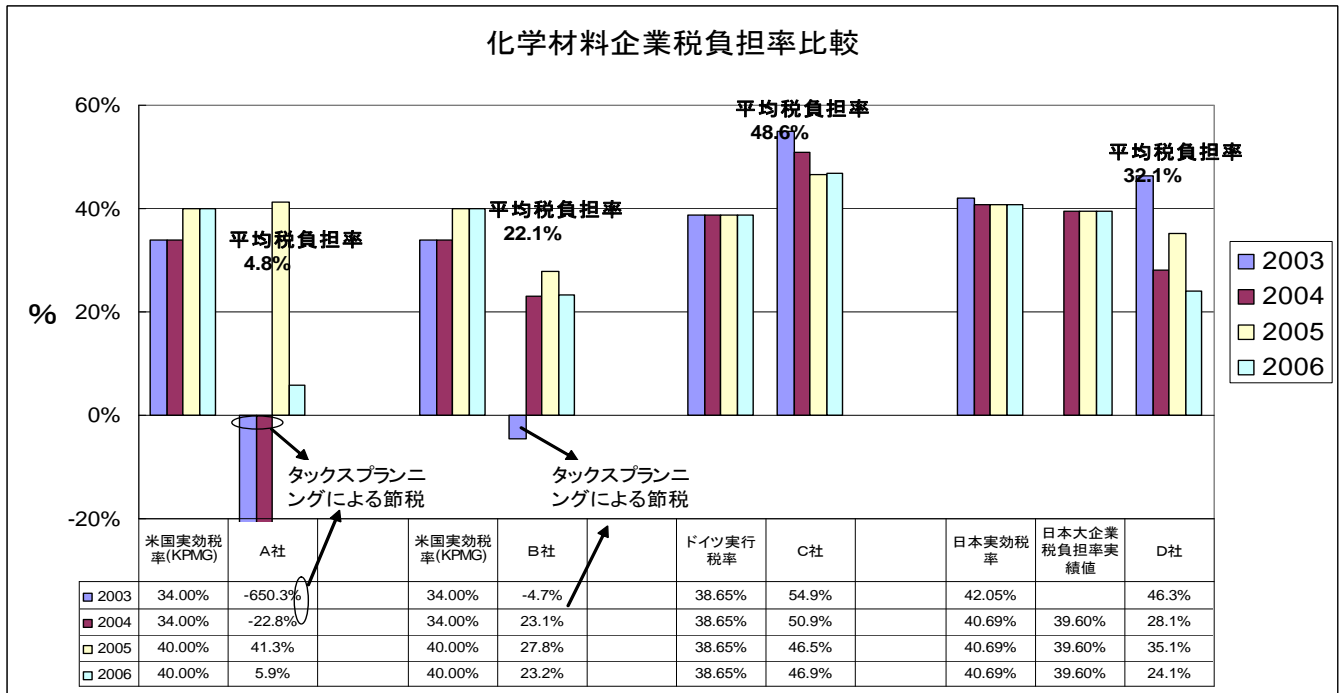


図-4 建設産業

台湾では土地売却利益免税となっている

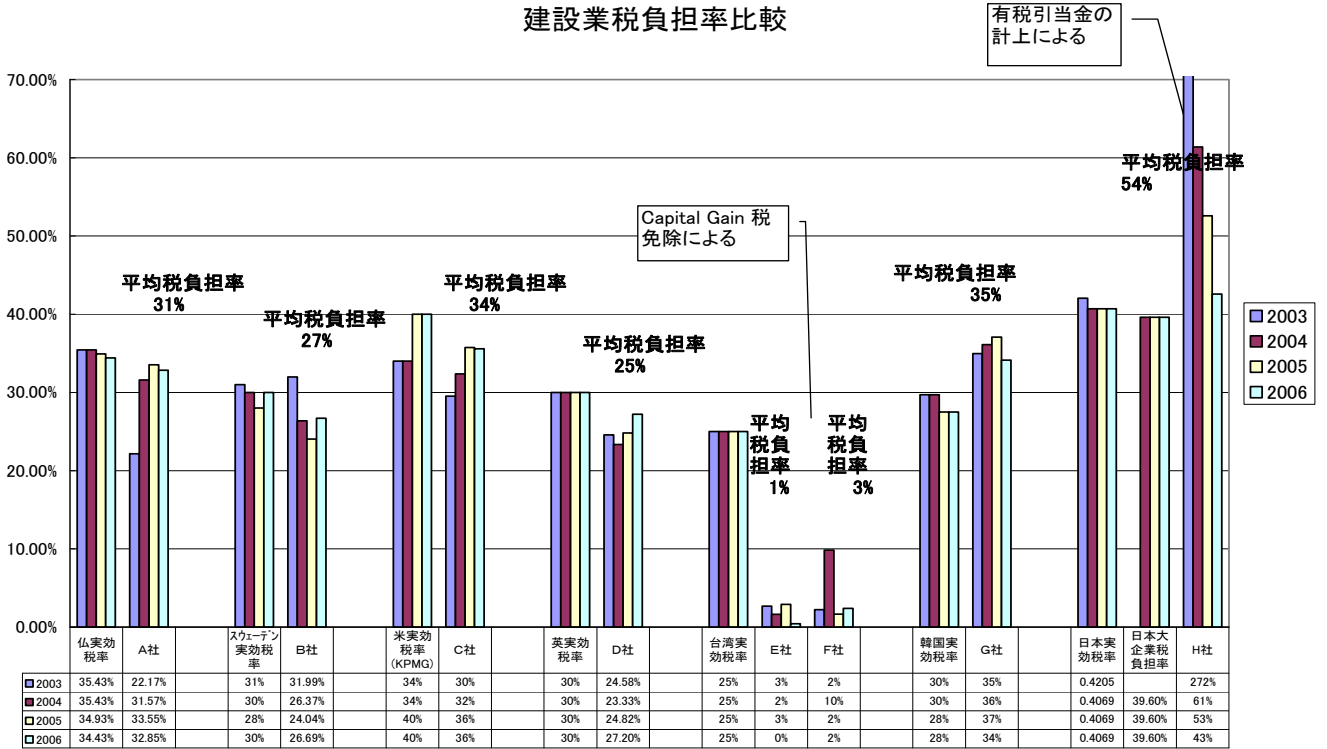
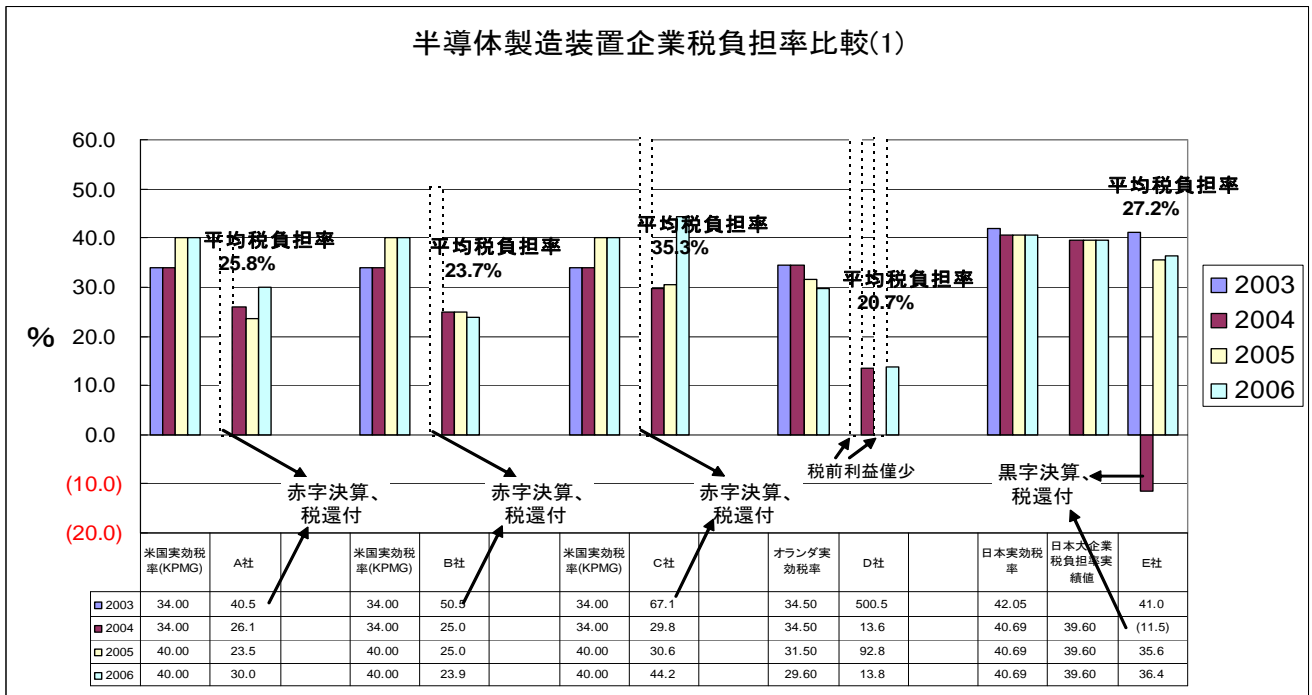
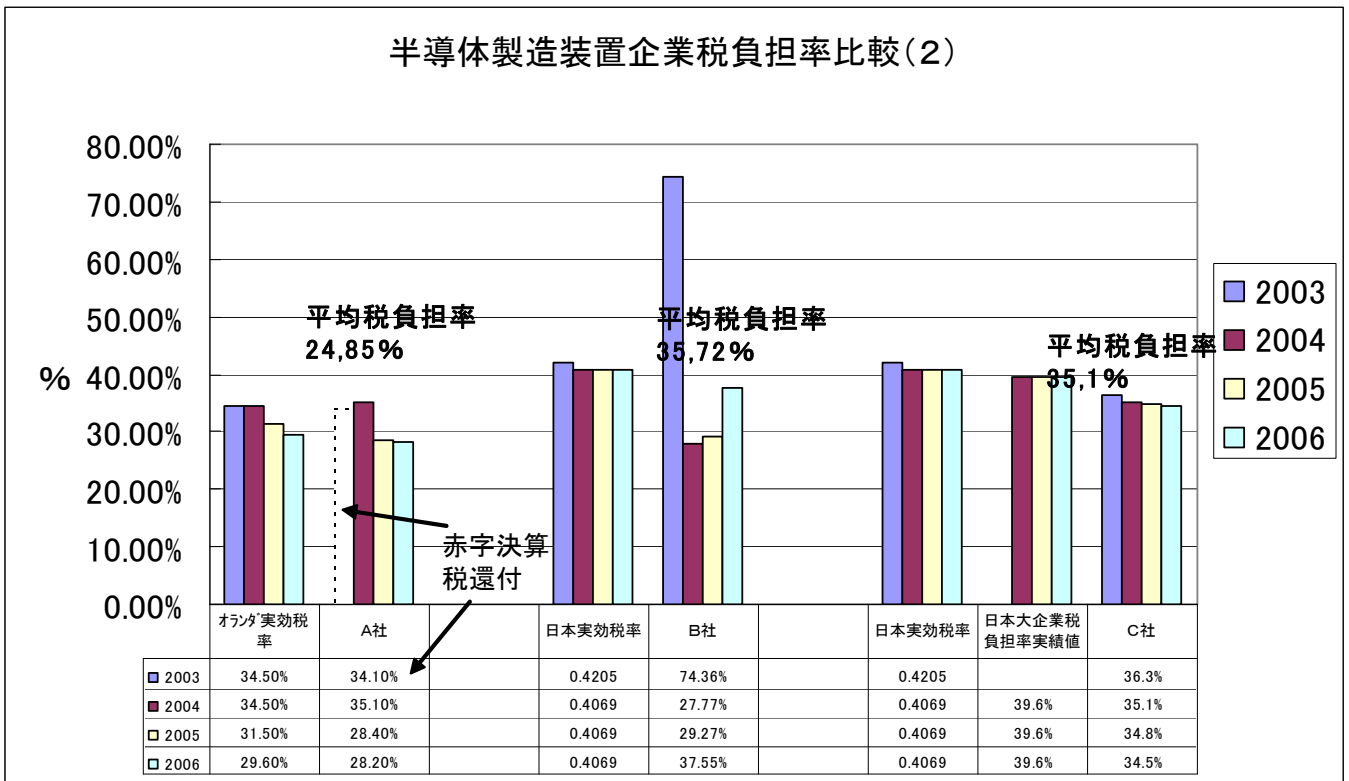


図-5 半導体製造装置産業



図一6 半導体製造装置産業（2）



6、産業政策と設備投資の関係

半導体産業で1位、2位の地位を占めるA社（米）、B社（韓国）を例にとって税負担と設備投資の関わりについて報告します。財務データは両社ホームページ年度報告、SEC 報告書（annual report）、設備投資額は Gartner 社データによります。税負担及び設備投資額の 2001 年～2006 年の 6 年間の累積データから日米税負担額差（A社の実際の税負担と日本の大企業 2004 年～2006 年税負担率実績平均値 39.6%による税額試算値との差）を調べたところA社では設備投資額 30,760M\$の 15.4%を占める 4,742M\$（約 5,500 億円）でした（図一7）。同様にB社では設備投資額 26,362M\$の 39%、10,261M\$（約一兆 1,900 億円）の税負担額差になっています（図一8）。この結果巨額な設備投資を実行することができたものと考えられます。図一9 参照ください。

米国；輸出優遇、州税優遇、製造所得控除等の税額控除他

韓国：25 業種への（臨時）投資税額控除（投資額の 10～15%税額控除）

図一7 米国A社税負担・設備投資

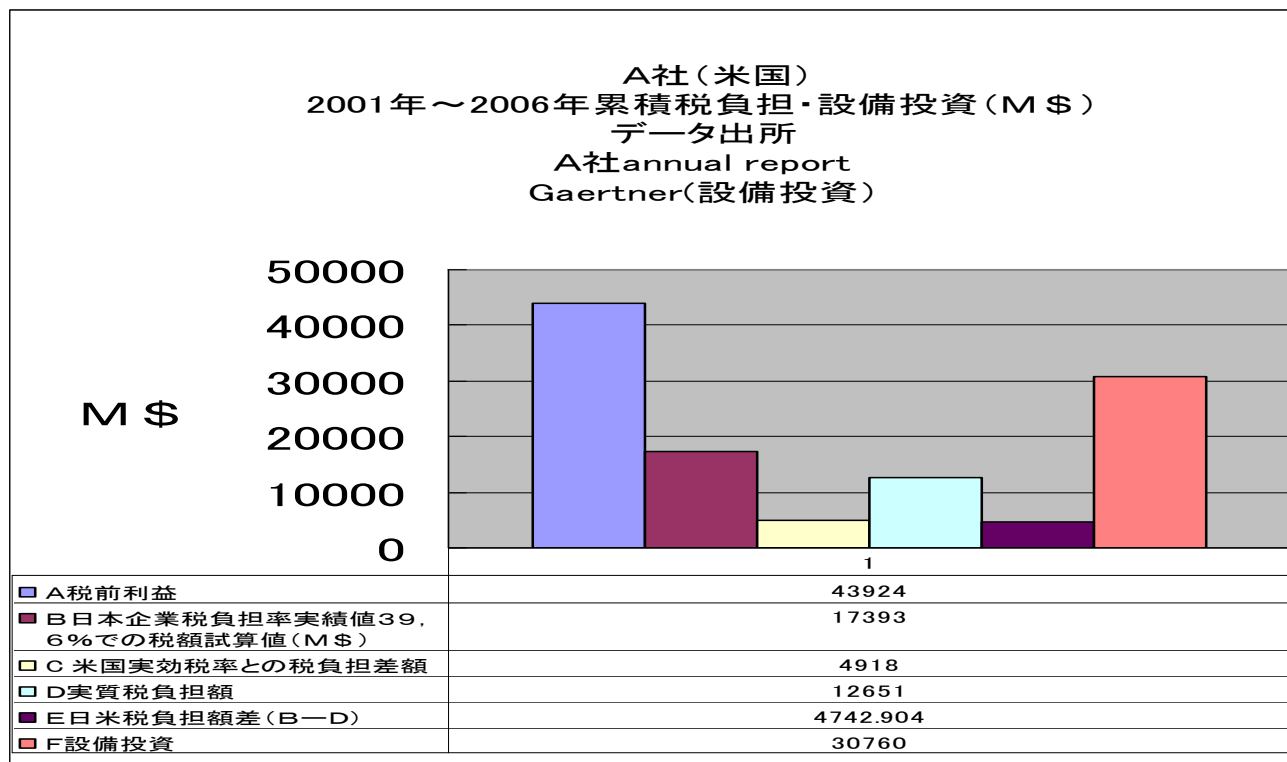


図-8 韓国B社

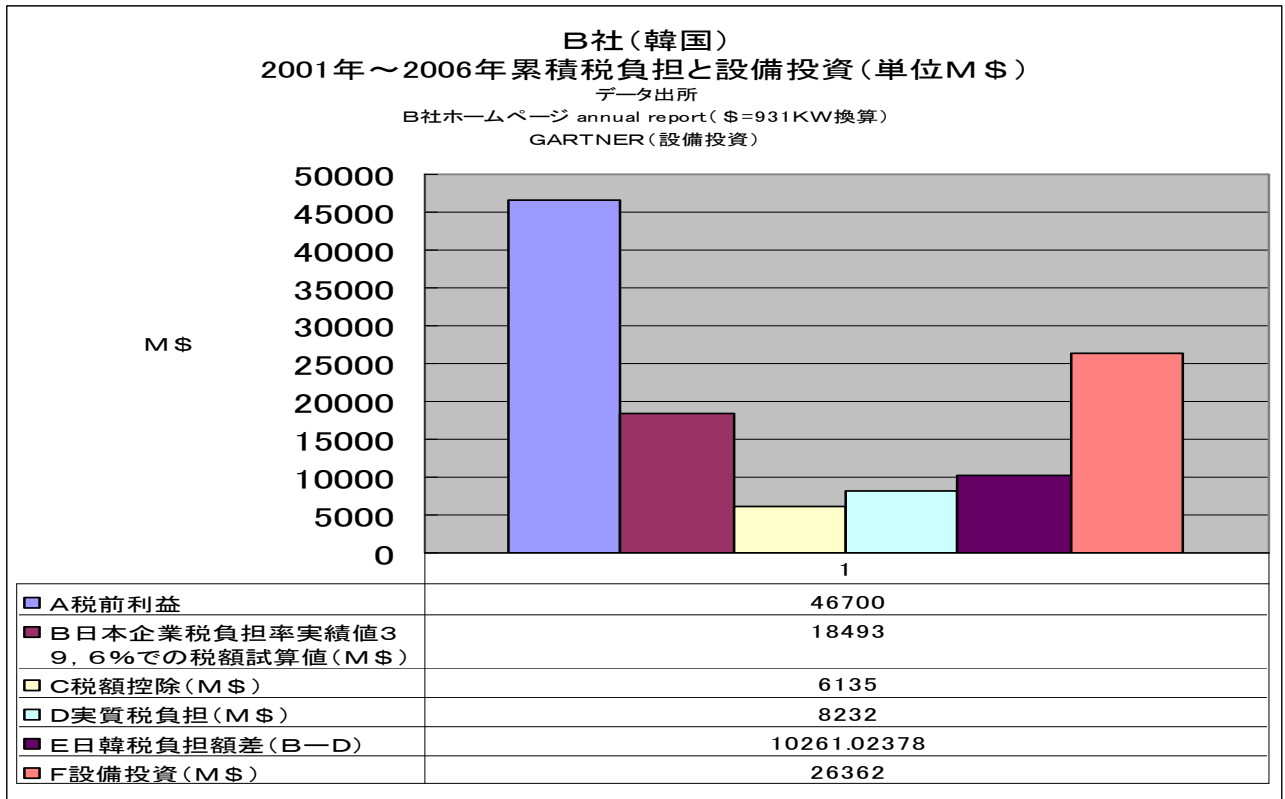
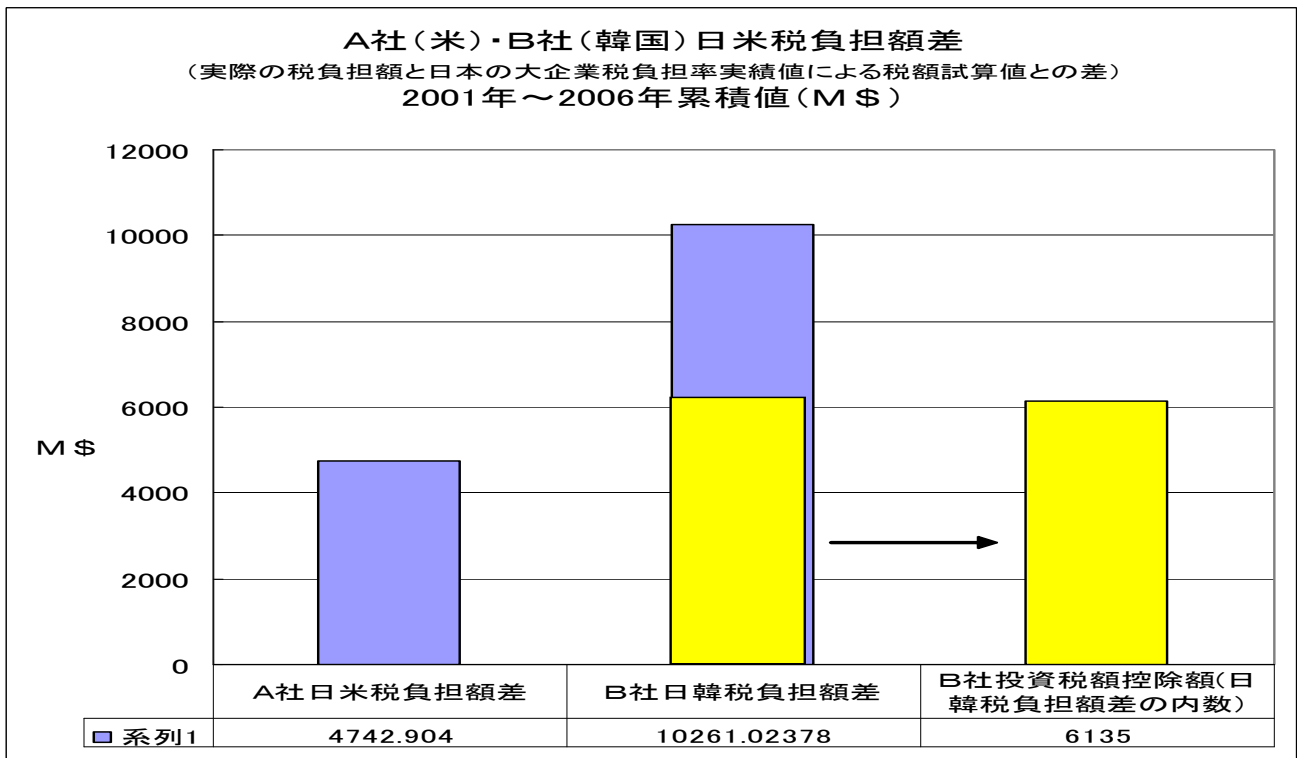


図-9 日本と米国・韓国企業の税負担額差(試算)



7、各国における産業振興策例（税制政策中心）

各国で実施されている産業振興策は雇用の促進、設備投資推進、研究開発促進及び産業誘致が挙げられますがその狙いは自国産業・企業の国際競争力を強化することにより経済の活性化を図り、また雇用の確保により社会を安定化させ国力を高めることにあると考えられます。

欧米先進国、アジア諸国、資源の少ない小国はそれぞれ独自のやり方を採用しています。

米国；雇用創出法による国内雇用確保・投資促進、海外子会社の配当金還流減税等あらゆる施策を展開。州レベルにおいても充実。

アジア諸国；先端産業投資促進、企業誘致により雇用確保。

欧州；先進国においては金融企業・研究開発型企業振興・誘致が中心。国土資源が乏しい国・後進国では産業誘致促進。

発展途上国；租税回避地（tax haven）として製造・金融・IT企業誘致。シンガポールは製造、先端企業、金融、研究開発、産業振興・誘致等々。

各国詳細は付属資料集 15 ページ各国産業政策集ご参照ください。

8、我が国の産業競争力を強化するために

産業競争力を高めていくためには研究開発への支援及び先端設備投資への支援が車の両輪と考えられます。利益剰余金からの税負担が少なければ企業はそこから生じるキャッシュをより多くの研究開発、先端設備投資へ振り向け、競争力強化を図ることができるものと考えます。

我が国の製造業における産業振興策は研究開発促進税制（試験研究費税制）が平成15年度に改正され、産業の競争力を強化する政策として高い評価を得ており、更に充実を望む声が大きくなっています。産業の競争力を考える上でもう一つ忘れてはならないのは先端設備への投資です。半導体分野でエルピーダ社が次期大型投資計画において台湾での合弁に踏み切った一因は我が国にはなく台湾に存在する産業振興政策を考慮した結果と言われています。

我々は税負担率に焦点をあてて産業・企業の国際競争力を調査してきましたが、我が国の産業・企業は欧米先進国、アジアの有力国にたいし大きなハンディキャップを背負っているのが実態です。産業競争力を高め、国内経済を活性化していくためには、**海外競争相手と平等な戦い**ができるよう、一企業の努力では克服できない**国際的に著しく高負担の実質税負担を改善する施策が重要な鍵を握っている**と考えられます。

具体的な直近の目標として

1) 研究開発をより活発に行うことを促進する施策

中長期目標として

2) 海外子会社で蓄積された利益を国内へ還流する際の課税を適正化すること

3) 国際的に **Equal Footing** な競争条件としての企業税制

が必要になってきています。

資料集 目次

各国産業政策集		ページ
	米国	15
	シンガポール	16
	中国、韓国、台湾、その他アジア	16
	EU諸国(オランダ、ベルギー、英国)	17
	日本	17
	米国雇用創出法詳細	17
世界各国実効税率推移		18
法人税率国際比較(日本の税制構造による国際比較)		20
	企業の財務データに基づく実質税負担率の業種別の国	
	法人所得課税が企業の立地選択に及ぼす影響	
主要産業における地域別シェア推移		21
	半導体産業、液晶パネル製造産業、鉄鋼産業、自動車	

各国産業政策集

内容	効果												
1、米国雇用創出法:2004年施行 American Jobs Creation of 2004 (外国貿易所得控除法がWTO違反裁定により段階的に撤廃されることになったことに伴う代替立法) 米国は旧くからあらゆる産業支援策を国、州の立場で実施している													
イ)国内製造業者の製造所得税額控除 2005年、2006年3%、2007年~2009年6%、2010年以降9%	雇用増加、企業競争力強化												
ロ)米国内で投資拡大を促すため海外子会社に蓄積された留保金を配当として本社に吸上げる際の税負担を大幅に軽減する 2005年時限立法 法人税率35%が5.25%へ軽減((配当金の85%所得控除) 米国内工場投資・設備投資、雇用増加策を実施することが条件	投資、雇用増加による経済活性化 配当還流実績:2005年約3,000億\$強の配当が米国に送還されてた ファイザー社290億\$、IBM社80億\$、インテル60億\$...												
	その他の支援策を含めて主要企業の税負担率は20%台後半~ 30%前後 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2004年</td> <td style="text-align: center;">2005年</td> <td style="text-align: center;">2006年</td> </tr> <tr> <td>インテル</td> <td style="text-align: center;">27.8%</td> <td style="text-align: center;">31.3%</td> <td style="text-align: center;">28.6%</td> </tr> <tr> <td>IBM</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">35%</td> <td style="text-align: center;">29%</td> </tr> </table> 注:2005年が高いのは海外からの巨額配当金への低税率課税分が上乘せされたため		2004年	2005年	2006年	インテル	27.8%	31.3%	28.6%	IBM	30%	35%	29%
	2004年	2005年	2006年										
インテル	27.8%	31.3%	28.6%										
IBM	30%	35%	29%										

2、米国州施策:多くの州が企業・産業誘致策で競い合っている(大半の政策は国内企業、外資問わない)、税制優遇も充実		
	<p>NY州の例: AMD社32nmプロセッサ工場への総額32B\$助成(出資+インフラ整備) INVENT(International Venture for Nanolithography 国際コンソーシアム)へ180万ドル支援 その他(製造、サービス、研究開発、観光...税優遇措置)</p>	<p>雇用増加、産業高度化 特定産業誘致(左記の他コンテンツ産業誘致熱心)</p>
3、シンガポール		
	<p>OHQ((Operational Headquarters)制度 マネージメントサービスを提供することを目的とした法人のマネージメントフィー、ロイヤリティ、受け取り利息等は法人税率10%へ低減(通常は20%)</p>	<p>企業誘致、経済活性化 海外大手企業の進出</p>
	<p>バイオニア事業優遇;認定事業(エレクトロニクス、化学、バイオ産業...)は非課税(5年~10年、延長可)</p>	<p>産業の高度化 海外大手企業の進出</p>
	<p>認定サイバートレーダー(Aproved Cyber-Trader ACT) インターネットオフショア取引は法人税10%、資本支出は50%の投資控除</p>	<p>シンガポールをインターネット取引の拠点化</p>
	<p>R&D優遇も充実;特定R&D費用の倍額控除、資本支出の100%控除他</p>	<p>産業の高度化、国際競争力強化</p>
4、中国		
	<p>二免三半減 外国投資黒字転換後2年間法人税免除、3年間半減 Tax heaven 認めている その他地方行政府では誘致目的の各種優遇措置あり</p>	<p>企業誘致 2008年から方針転換しハイテク産業等高付加価値産業適用重点 SMIC社はCayman islandに設立されたtax exempted company(非課税会社)</p>
5、韓国		
	<p>七免三半減(外国投資促進法): 7年間税免除、3年間税半額 法人について外国資本投資持分割の税控除</p>	<p>合併事業優遇により外国技術の導入</p>
	<p>臨時投資税額控除: 製造業他25業種について10%~15%税額控除 国内、外国資本問わない</p>	<p>設備投資が大きい半導体、液晶パネル事業では産業育成効果顕著 サムスン社は6年間(2001年~2006年)で巨額設備投資の見返りに総額6.135M\$(\$=931W換算)の税額控除を受けている</p>
6、台湾		
	<p>五年免税: 先端産業奨励税制としてハイテク産業投資は5年間免税 そのほかに輸入機器関税控除、設備の特別償却制度あり</p>	<p>* 半導体、液晶パネル事業をはじめとするハイテク産業の隆盛 * エルピーダ社が次期投資先として台湾を選択した一因と言われている * TSMC社SECレポートによれば2,003年~2005年における実効税率による税額MNT\$60,382にたいし税控除額はMNT\$56,108(93%控除、約2100億円)</p>
7、他のアジア諸国:多くの国々で企業誘致税制支援制度がある		

8、EU諸国：先進国では金融企業・研究開発型企業優遇、誘致が中心		
	オランダ：tax holiday(外国からの新技術企業の投資に対し一定期間税額控除)	STMicroelectronicsのSECLレポートによると2003年～2005年の3年間で192M\$の税額控除を受けている。欧州各国でも同様な税制ありと記載されている
	ベルギー： * コーディネーションセンター制度 多国籍企業が統括会社をベルギーに設置した場合、コストプラス課税方式を採用 課税所得=(運営経費-一定経費)×一定% 会社の所得には課税しない * みなし利息控除制度 資本支出を借入れとみなし利子相当額(10年国債利率)の所得控除	企業誘致 (オランダ、ルクセンブルグも類似の産業税制あり)
	英国： 産業振興地域税制(10年間建物地方税免除、建物初年度償却可能) 海外領土ではタックスヘイブン	ジブラルタル、ジャージー諸島はタックスヘブンであり特に保険会社への優遇が税制がありEUにおけるオフ・ショアの金融センターになっている。
9、わが国における産業振興政策		
	製造業を振興する施策は平成15年度税制改革において試験研究費税が改正されたものにとどまっている 特に諸外国で多く採用されている設備投資支援が弱い	産業の高度化、競争力強化
	R&D(試験研究費)政策 ①売上高試験研究費の10%税額控除(税額の20%までの条件を緩和してほしいとの要望が多い)②増加試験研究費の15%税額控除の選択	産業の高度化、国際競争力強化

2004年米国雇用創出法

American Jobs Creation of 2004

出所：PricewaterhouseCoopers(中央青山 2005年1月レポート)

1、概要

狙い：米国内企業国際競争力強化、米国内投資促進、雇用増

- 1) ETI(Extraterritorial Income) (輸出販売所得控除、外国貿易所得控除という)に係わる所得控除の撤廃
- 2) 国内製造業者所得に係わる所得控除・・・既報告
- 3) 海外子会社からの配当に係わる所得控除
- 4) 外国税額控除の改正
- 5) CFCのサブパートF所得の改正(若干緩める)
サブパート所得課税：海外タックス・ヘブン国に留保しての課税回避分をサブパート所得として課税
- 6) タックスシェルターに関する報告義務不履行に対するペナルティ(情報開示、報告内容精度に関する罰則規定)
- 7) その他

2、ETI(Extraterritorial Income域外所得)に係わる所得控除(輸出販売所得控除)の撤廃

輸出販売所得控除法がWTO違反裁定により撤廃されるがその経過措置を定めた。

2004年：ETI税制のもとでの所得控除される額の100%

2005年：同上の80%、2006年：同上の60%、2007年以降適用なし

3、国内製造業に対する所得控除

適格と認められる製造所得から生じた所得(適格製造所得)から一定割合の所得控除。

* 適格製造所得=国内製造売上げ(売上原価+関連マーケティング費用)

* 所得控除率

2,005年度、2,006年度： 3%

2,007年度～2,009年度： 6%

2,010年度以降： 9%

控除額は以下の3つの内最も少ない額

①適格製造所得に控除率を乗じた額②源泉徴収票記載の支払賃金総額の50%

③国内製造所得控除の適用前の課税所得に控除率を乗じた額

* 国内製造売上げとは

①米国内で全部または重要な部分が製造・栽培・抽出された製品(有形動産、ソフト・・・含む)の販売・交換・リース・賃貸・ライセンス

注、重要な部分とは直接労務費・操業費用が原価の20%以上占める場合

②米国内建設行為

③米国内建設プロジェクトに対するエンジニアリング、及び設計サービス

④人件費の50%以上が米国内で提供される映画製作、テレビ番組・・・のリース・賃貸・ライセンス・販売

⑤米国納税者により製造された電気、天然ガスまたは携帯用飲料水のリース、賃貸、ライセンス、販売または交換

4、海外子会社からの配当に係わる所得控除

一定の要件を満たす海外子会社からの受け取り配当金について選択により、その85%を課税所得控除できる。

* 一定の要件;

(注: 15% × 法人連邦税率35% = 5.25%)

①海外子会社からの現金配当であること

②米国内での再投資計画に基づき当該配当が再投資されること、経営陣の承認要す

米国内投資には従業員雇用・研修、インフラ整備投資、研究開発投資・・・も含まれる

③受取配当金のうち基準5年間の配当金額のうち一番多額・小額をのぞいた3年間の平均値を超える金額が適格配当金とされる

④適格配当は以下の金額の内、最大のものを超えないこと

a) 5億\$

b) 財務諸表上にて国外において永久に再投資される金額として報告されている留保所得 (APB23所得) 以内

5、外国税額控除制度改定

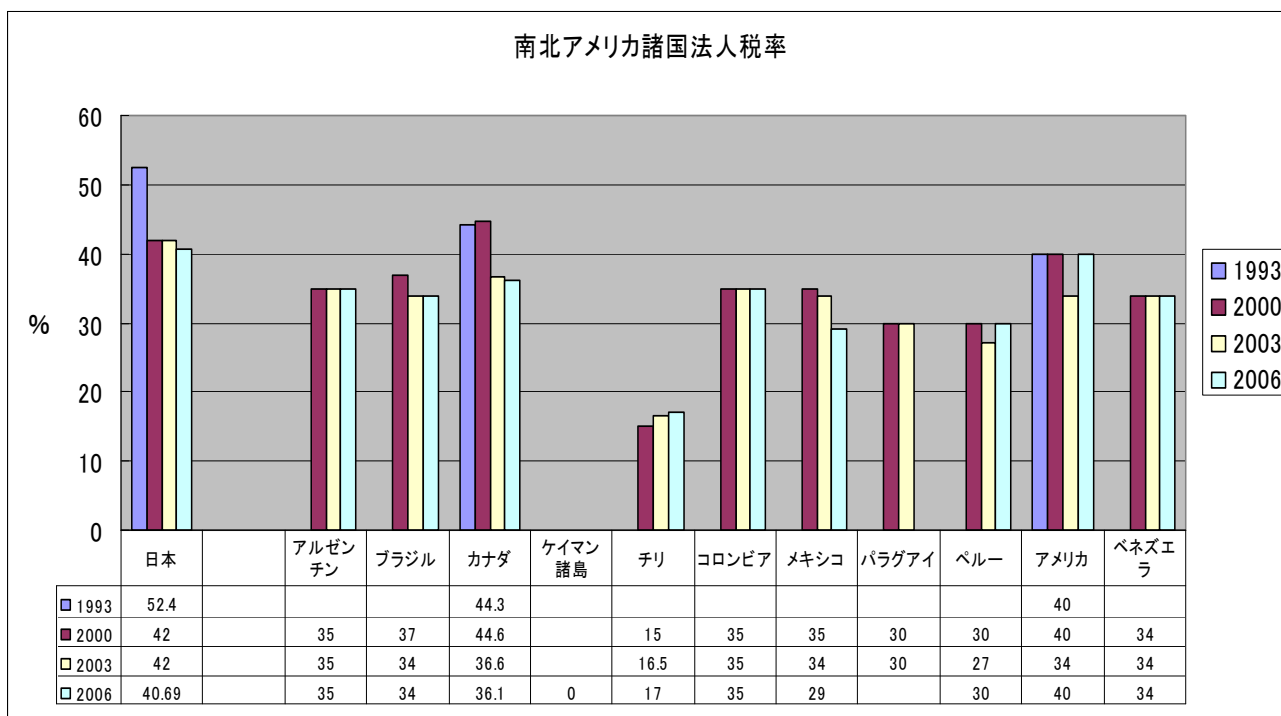
①外国税額控除繰越期間を10年間へ延長(従来は5年間) ②代替ミニマム税の90%控除制限の撤廃

* 代替ミニマム税 (ATM Alternative minimum tax); 特別措置・税優遇による著しい低税負担(税金逃れ) 防ぐ目的の税法。特別な計算法による試算税額 (tentative minimum tax) との差額を代替ミニマム税として加算。

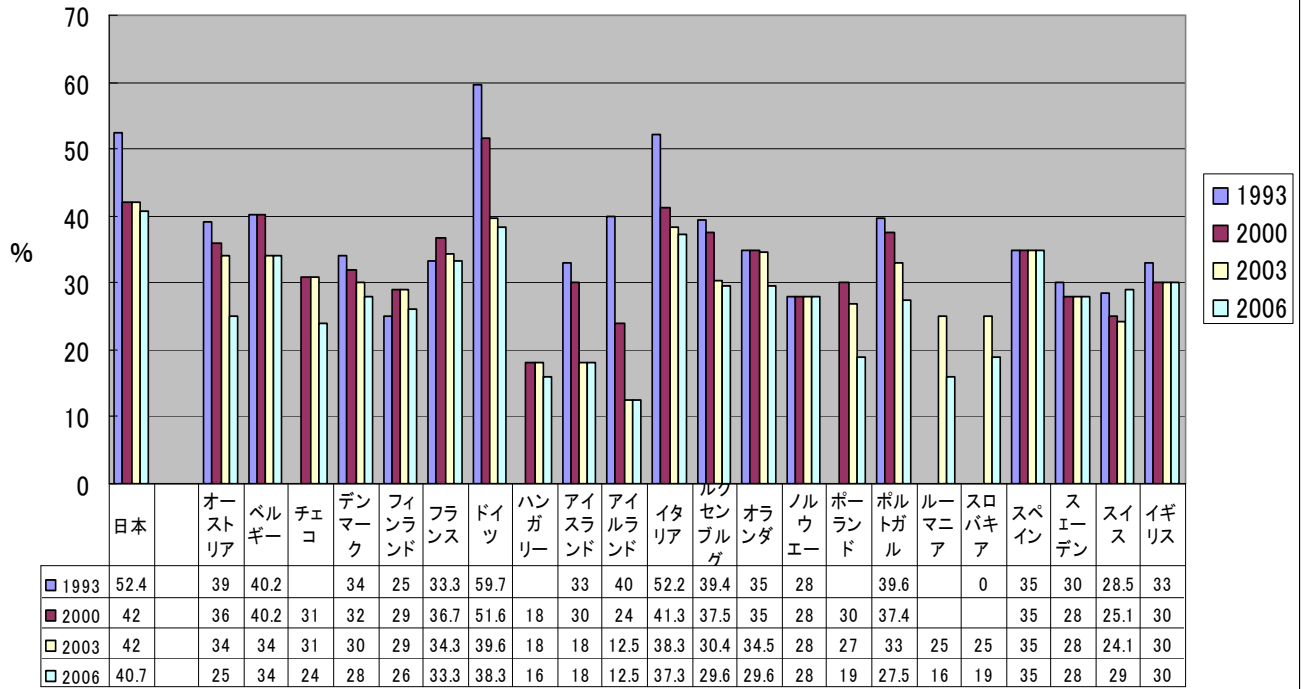
③その他

世界各国実効税率推移

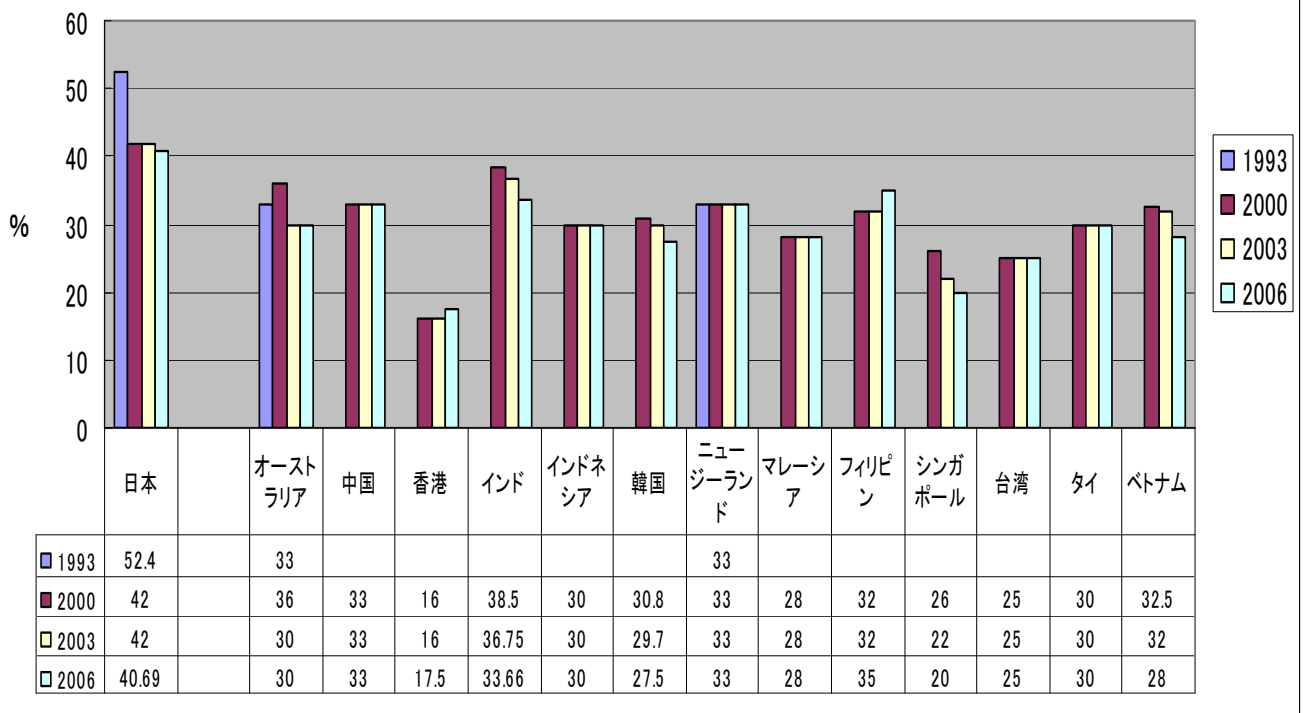
出所: KPMG



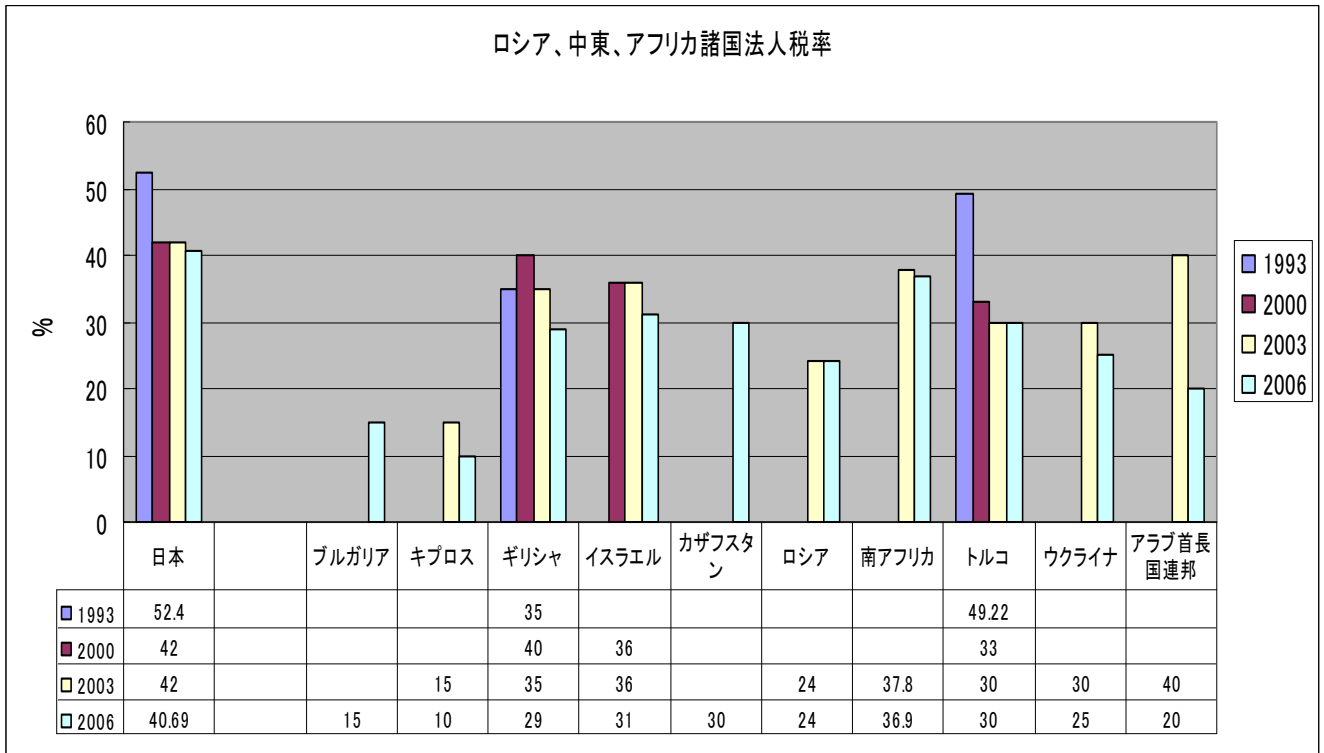
欧州諸国法人税率



アジア諸国法人税率



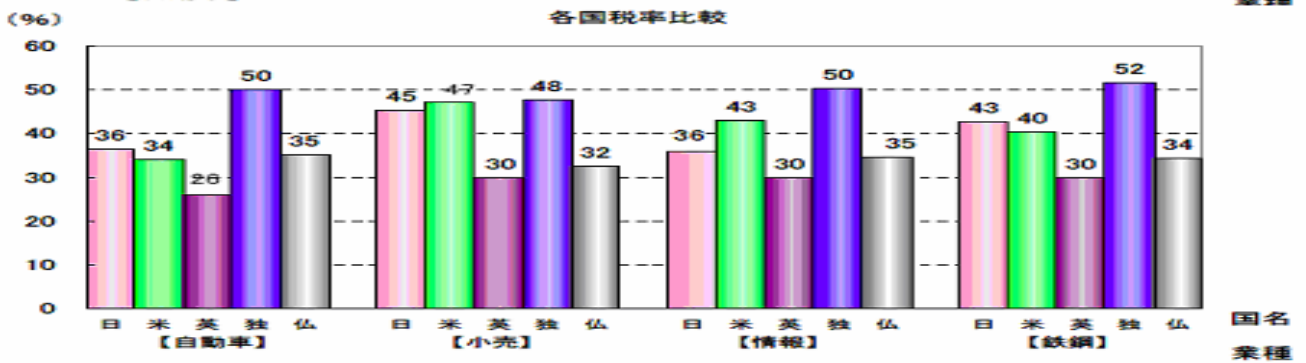
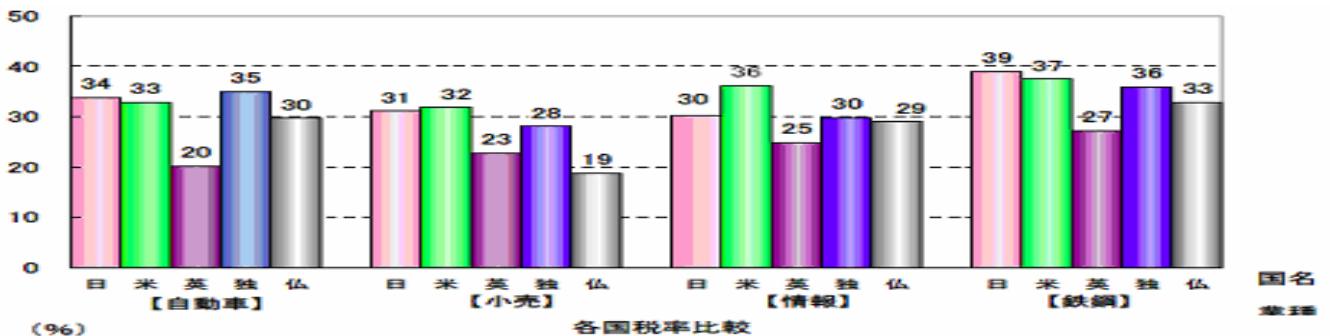
ロシア、中東、アフリカ諸国法人税率



法人税率国際比較

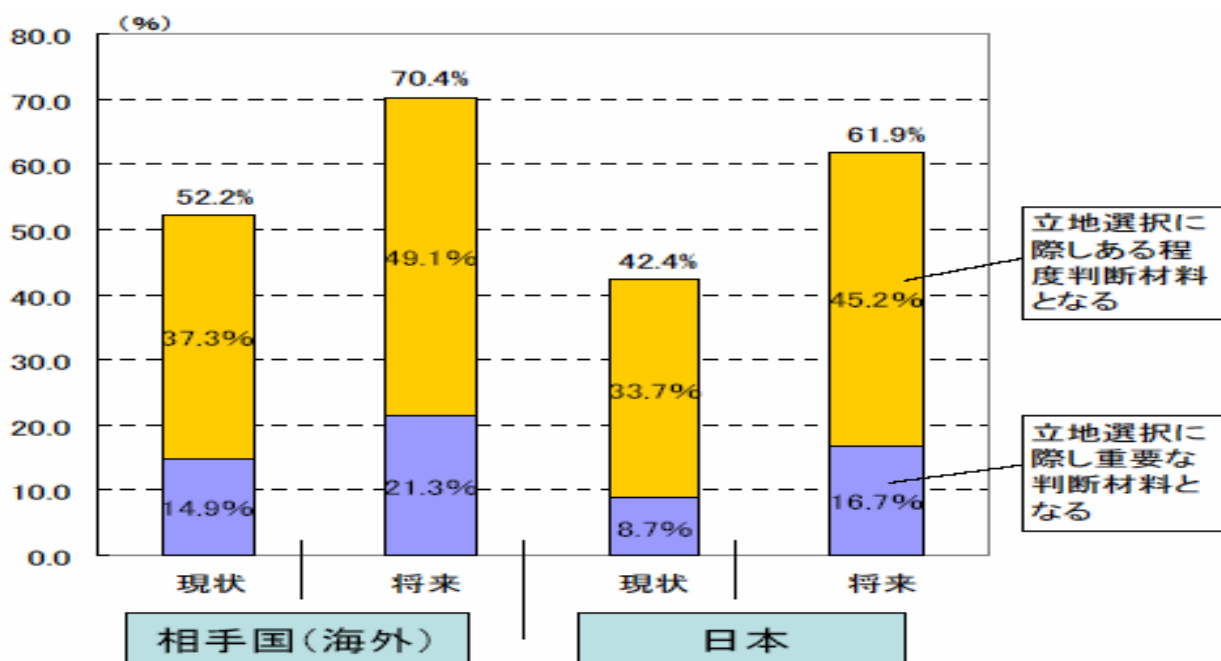
(内外税率差による国際比較であり、各国特有の政策税制は反映されていません)

企業の財務データに基づく実質税負担率の業種別の国際比較



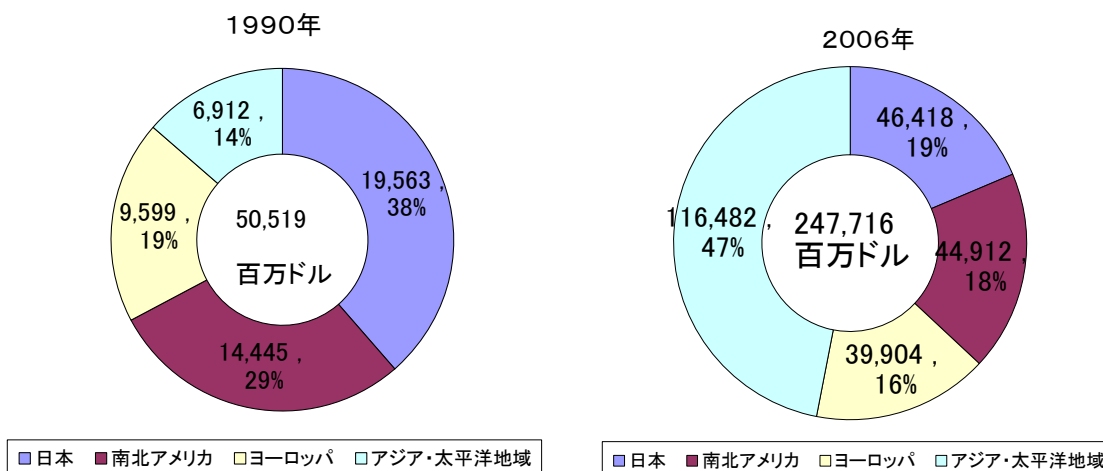
出所：経済産業省委託調査・KPMG税理士法人「法人所得課税負担に関する国際比較調査報告書」2005年4月

法人所得課税が企業の立地選択に及ぼす影響



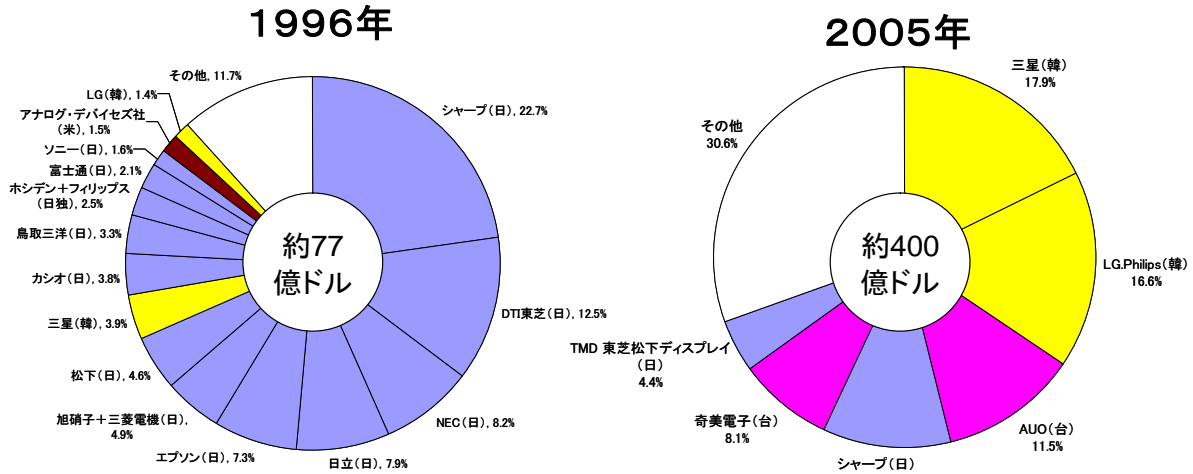
半導体産業地域別生産推移

出所: WSTS



液晶パネル生産推移

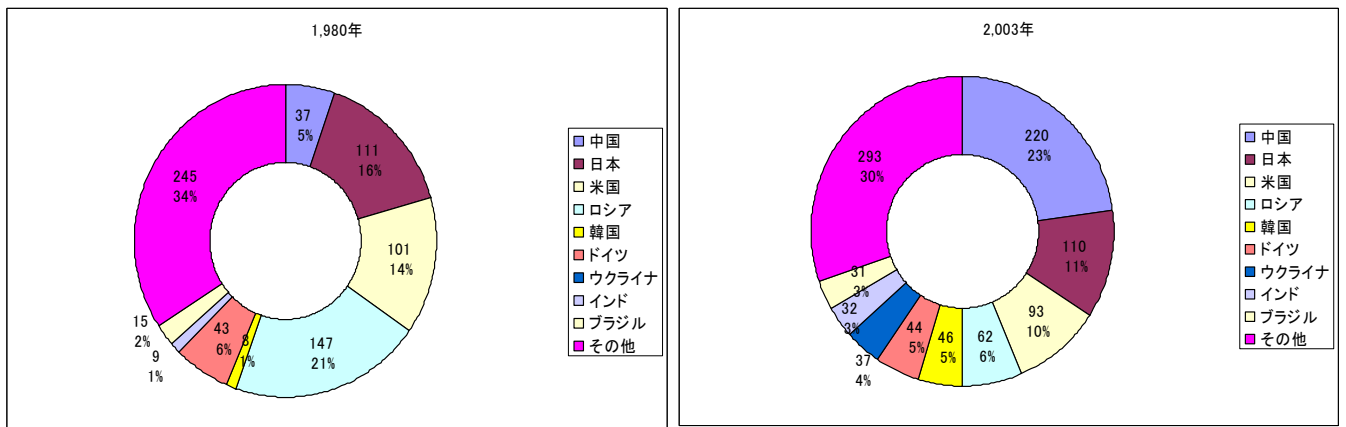
日本で産業育成したものの
台湾・韓国に負けた



出典：
1996年：ディスプレイ・サーチ社調べ 1996年『LCDダイブ別(1996金額ベース)』28page
2005年：経済産業省報告書『経済社会の持続的発展のための企業税制改革に関する研究会』

鉄鋼産業 地域別粗鋼生産量推移(単位百万トン):上段 シエア:下段

日本は高付加価値化で生き残る
シームレス、高張力鋼板……



1,980年 ロシアは旧ソ連

1,980年合計 716,300千トン

B(R)ICS,韓国が躍進

2,003年合計 968,000千トン

データ出所: 国際鉄鋼連盟

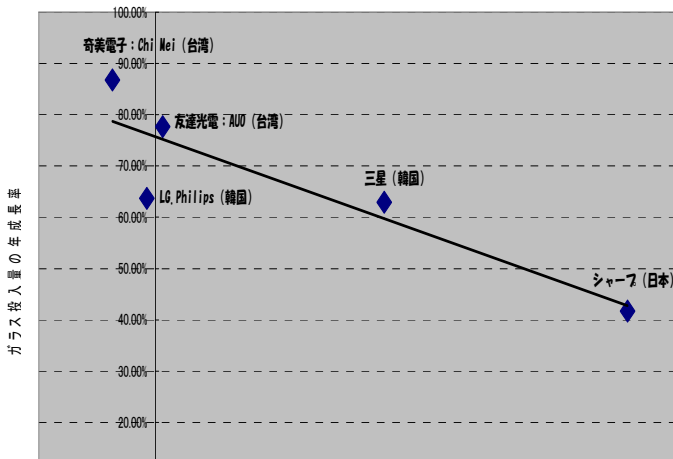
液晶パネル産業成長率と税負担率の関連

(税負担率だけではないが)

調査結果; 税負担率と成長率の相関

台湾財務省が用意した税免除

税負担率と成長率の相関図(液晶パネル産業)

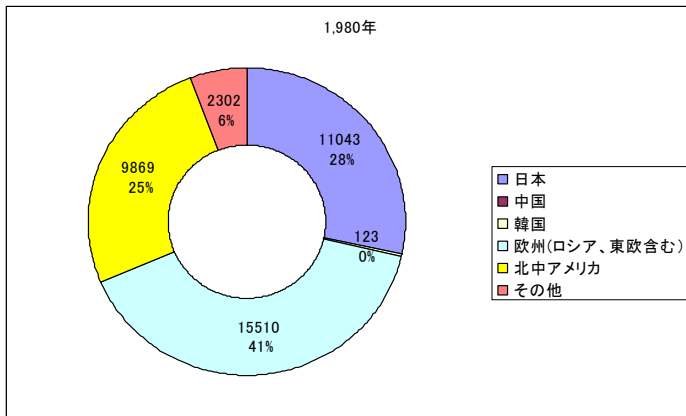


Year of investment	Tax incentive chosen	Tax exemption period
1999	Tax exemption of the Company's L3A facility corporate income taxes for four years	2002-2005
1996	Tax exemption of the Company's L5 facility corporate income taxes for five years	2003-2007
1999	Tax exemption of the Company's L3B facility corporate income taxes for four years	2005-2008
1999, 2001	Tax exemption of the Company's L6 facility corporate income taxes for five years	2005-2009

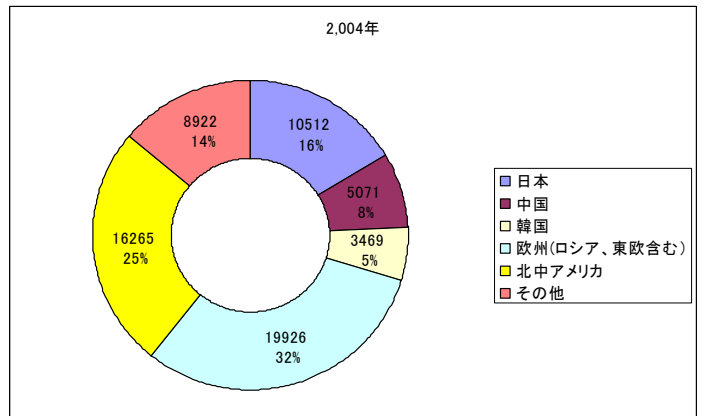
出典: SEC 20-F 2005 『14. Income Taxes』

自動車産業 地域別生産台数(単位千台): 上段 シェア: 下段

日本は高品質車、海外消費地での現地生産、低人件費国生産へ



1980年 合計38,847千台



2,004年 合計64,165千台

その他地域増加寄与はインド、タイ、ブラジル等

データ出所: 国際自動車工業連合会、日本自動車工業会

産業競争力懇談会（COCN）

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 〒100-8280

日本生命丸の内ビル（株式会社日立製作所内）

Tel : 03-4564-2382 Fax : 03-4564-2159

E-mail : cocn.office.aj@hitachi.com

URL : <http://www.cocn.jp/>

事務局長 中塚隆雄